

有機材料開発用成膜装置 ラインナップ

型式	KVD-OLED Evo.	KVD-OLED Evo.	KVD-OLED Evo.	KVD-OLED Evo.Cluster	
装置写真					
装置外観 PDF					
装置構成					
成膜室 (部屋数)	有機金属共通: 1	有機金属共通: 1	有機: 1 有機金属共通: 1	有機: 2 金属: 1	
蒸着源 (元)	有機: 6 金属: 3	有機: 8 金属: 2	有機: 8+6 金属: 3元	有機: 8×2 金属: 5	
基板サイズ (inch)	2				
膜厚分解能 (/s)	0.0057 /s (INFICON社 CYGNUS使用)				
膜厚センサー導入数 (基)	有機金属共通: 4	有機金属共通: 4		有機: 8 金属: 2	
膜厚センサー冷却方式	水冷 (チラーより0.01 まで制御可)				
有機材料共蒸着	可 (独自のコントロール手法によりホスト1 /s時ドープ混合率0.1~30wt%)				
面内分布 (%)	50mmにて有機膜±3%以内、金属膜±5%以内				
前処理室 (室)		1 (基板加熱)		1 (プラズマ洗浄)	
導入室ストッカー数 (段)	5	5	4×3 (列)	4	
到達圧力 (Pa)	成膜室+その他	10 <sup>-6</sup> 台			
	導入室	10		10 <sup>-5</sup> 台	
真空排気系	成膜室	クライオポンプ			
	前処理室		クライオポンプ	ターボ分子ポンプ	
	導入室	ドライポンプ		ターボ分子ポンプ	
		ドライポンプ (粗引きポンプ)			
入力電源	3 200V 75A	3 200V 130A	3 200V 150A	3 200V 200A	
自動排気				標準装備	
自動ベント				可 (オプション)	標準装備
自動搬送					標準装備
自動蒸着					標準装備
蒸着時の基板加熱	可 (オプション)	可 (オプション)			
グローブボックス接続	可 (オプション)			可 (オプション)	
装置のみ設置スペース (mm) 装置全体図PDF	2600×1200	3800×1200	3900×1200	2000×2000	

\*その他御客様の仕様に合わせて製作を承っておりますので、弊社までお問い合わせください。

北野精機株式会社  
<http://www.kitano-seiki.co.jp>  
 E-mail: info@kitano-seiki.co.jp